

國立中山大學半導體及重點科技研究學院
半導體聯合實驗室設備收費辦法

114 年 3 月 4 日本校半導體學院 113 學年度半導體聯合實驗室營運管理委員會通過

一、 高精度雷射直寫曝光系統收費辦法

收費標準(單位：元/時)	自行操作	委託操作
學術單位	1500	2000
業界單位	3500	

二、 奈米級金屬氧化物薄膜共濺鍍熱處理系統收費辦法

收費標準(單位：元/時)	自行操作	委託操作
學術單位	1000	1500
業界單位	2000	

三、 雷射冷凍聚焦離子束掃描式電鏡收費辦法

收費標準(單位：元/時)	自行操作	委託操作
學術單位	2500	3500
業界單位		8000

四、 濕式工作槽(Wet bench)收費辦法

收費標準(單位：元/次)	自行操作	委託操作
學術單位	400	600
業界單位	800	

五、 打線機收費辦法

收費標準(單位：元/時)	自行操作	委託操作
學術單位	250	500
業界單位	1000	

六、 點膠機收費辦法

收費標準(單位：元/時)	自行操作	委託操作
學術單位	500	1000
業界單位	2000	

七、 烤箱(Epoxy Cure)收費辦法

收費標準(單位：元/時)	自行操作	委託操作
學術單位	150	250
業界單位	600	

八、 烤箱(UF Cure)收費辦法

收費標準(單位：元/時)	自行操作	委託操作
學術單位	200	300
業界單位	800	

九、 本辦法經委員會審議通過後實施，修正時亦同。